

高真空蒸着装置 ED-1500Rハイエンド型



高真空蒸着装置ED-1500Rハイエンド型は従来のED-1500Rスタンダード型に付加価値として液体窒素トラップと基板加熱機構を装備した装置です。ED-1500Rスタンダード型同様、抵抗加熱と電子銃を標準装備しております。有機物、金属、貴金属、酸化物の成膜も容易にできます。電子銃のルツボは2.9mlを3点、抵抗加熱も3点有しておりますので、多層膜の成膜も可能です。また水晶振動式膜厚計を標準装備しており、膜厚計からの成膜制御も自動で行えます。排気系はクリーンポンプとしてターボ分子ポンプ550L/secを採用しておりますので、オイルミストや排気時間も気になりません。

高真空蒸着装置ED-1500Rハイエンド型仕様

- 到達圧力 1.0×10⁻⁵Pa以下※常温・無負荷・脱ガス・液体窒素投入時
- 真空室径 φ500mm×550mmH水冷巻 SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃最大投入電力:5KW
ルツボ容量:2.9ml
ルツボ個数:4個
抵抗加熱最大電力:AC5/10V0.5KVA
抵抗電極数:3対(バスケット状フィラメント)
- 基板形状 27mm×70mm 2枚
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.5KW×1式
常温～300℃迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:667/800L/min[50Hz/60Hz]
ターボ分子ポンプ:550L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 制御系 ターボ分子ポンプコントローラ
- 操作方法 手動
- ユーティリティ電気:AC200V三相8KVA
冷却水:15L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
寸法: 装置架台本体:955mmW×780mmD×(1513)mmH
制御盤:585mmW×800mmD×(1825)mmH